



本記事は, 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 秀でた利用6大成果について紹介するものです.

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム平成 27 年度秀でた利用 6 大成果 複合金属酸化物ナノワイヤの合成と構造解析

首都大学東京 村山 徹,神奈川大学 Zhang Zhenxin,広島大学 定金 正洋,神奈川大学 上田 渉 北海道大学 坂口 紀史



(左から)首都大学東京 村山 徹,神奈川大学 Zhang Zhenxin,広島大学 定金 正洋,神奈川大学 上田 渉,北海道大学 坂口 紀史



ナノワイヤ(断面積が10nm×10nm程度であり、長 軸方向へ繰り返し構造を有する)は、高表面積を有して いること、およびユニークな構造特性によってもたらさ れる量子力学的挙動などで注目されている. ナノワイヤ を形成する化合物として、金属化合物 [1]、半導体化合物 [2][3][4][5][6][7][8][9][10], 金属酸化物 [11][12][13], 有 機ポリマー [14][15][16][17] 等の種々の化合物が知られ ており、機能材料や機能デバイスとして触媒 [18]、各種 センサ [13], トランジスタ [2][5], 半導体 [3], フォトニ クスデバイス [7][11],および太陽電池 [4][6] の分野に応 用されている.様々なタイプのナノワイヤのうち、特定 の軸に沿った単一の分子単位の繰り返しによって成長す る分子ナノワイヤの合成が注目されている. 分子ワイヤ の最も一般的な例は、有機または有機金属ポリマーであ り [14][15][16][17], ナノテクノロジー,半導体,電気化 学,および細胞生物学に広く応用されている.

我々は,全てが無機化合物から成る分子ワイヤに注目 した.無機化合物は,熱的,機械的に安定であり,化学 組成の制御により化学特性が調整できるという利点を有 する.しかしながら,これまで全て無機物から成る分子 ワイヤ報告例はほとんどなかった.無機分子ワイヤの唯 一の例は,Mo₆S_{9-x}I_x分子ユニットを c 軸方向に沿って集 積させ Mo₆S_{9-x}I_x分子ナノワイヤである [19][20].この材 料は,優れた電子輸送能,磁気特性,機械特性,摩擦特性, 及び光学的特性を示し,化学センサ,バイオセンサ,電 界放出素子,複合材料,潤滑剤,非線形光制限材料,リ チウム電池,分子スケールのコネクタなどに応用されている.

これまでの研究において,我々は遷移金属の酸素八面 体のユニットの集積により,3D規則的多孔体構造を合 成できることを報告してきた.また,この方法によって, OD分子ナノドット(ポリオキソメタレート(POM))お よび,2次元分子ナノシートが得られることが報告されて いる[21][22][23][24][25].この遷移金属の酸素八面体の ユニットの集積によりナノ構造材料を形成するアプロー チが,無機分子ワイヤの合成に適用できると考えた.こ のような遷移金属八面体構造で組み立てられた分子ナノ ワイヤは,これまで報告されていない.

POM は,遷移金属の酸素八面体をベースにし多次元の 金属酸化物を構成するための理想的なサブユニットであ り,POM をベースとした無機化合物の結晶構造の例が報 告されている [26][27][28].しかし,遷移金属酸化物から 成る無機物の分子ワイヤを単離した例は報告されていな い.今回我々は,[X^{IV}Mo^{VI}₆O₂₁]²⁻(X=Te 又は Se)で構成 されるユニットが *c* 軸方向に積層した遷移金属酸化物の 分子ワイヤの集積体である結晶性 Mo-Te 酸化物または結 晶性 Mo-Se 酸化物の合成を報告する.結晶性 Mo-Te 酸化 物は,全て無機物から成るナノワイヤの単離が可能であ る.Mo-Te 酸化物のナノワイヤは,酸触媒として活性を 有しており,熱処理によりバンドギャップが容易に制御 できることから,触媒及び電子デバイスなど様々用途に 応用できる可能性がある [29].

このナノワイヤの様な微小スケールの分析は,高分解 の透過型電子顕微鏡や走査型電子顕微鏡での観察が必要 不可欠である.我々は,これら微細構造の分析について 前身であるナノテクノロジーネットワーク,文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業・微細構造解析 プラットフォーム(北海道大学)を利用して種々の装置 を積極的に活用させて頂いている.本稿では,ナノテク ノロジープラットフォーム事業の支援により得られた成 果の中から,ナノワイヤ集積体である結晶性 Mo-Te 酸化 物および結晶性 Mo-Se 酸化物の合成と,酸化物からナノ ワイヤを単離した結果について紹介する.



2.1 Mo-Te 系酸化物の合成

(NH₄)₆Mo₇O₂₄•4H₂O (1.766g, Mo10mmol) を 水 20mL に溶解させTe(OH)₆ (0.391g,1.7mmol) を加え た (溶液 A). VOSO₄•5H₂O (0.6438g, 2.5mmol) を水 20mL に溶解させた (溶液 B). 溶液 B を溶液 A に素早 く加え 10 分間撹拌した後, N₂ で 10min バブリングし た. 混合溶液を 50mL のテフロンライナーに移し, ステ ンレス製オートクレーブにて 448K にて 24h 水熱合成を 行った. オートクレーブを室温に冷却した後,得られた 固体を濾過により溶液から回収した.得られた固体を水 10mL で 3 回洗浄し, 353K にて一晩乾燥し, Mo-Te 酸化 物を得た (Mo 基準の収率:58%). 元素分析結果:計算 値 N₂Mo₆Te₁O₂₄H₁₄; N,2.48; Mo, 50.98; Te, 11.30; H, 1.24; V, 0,実験値: N, 2.49; Mo, 51.59; Te, 11.13; H, 1.22; V, 0.

低温にて Mo-Te 酸化物結晶を合成する場合,上記と 同様に調製した溶液を密閉し,約3ヶ月間冷蔵庫内で 保存した. Mo-Te 酸化物の結晶を遠心分離(3500rpm, 5min)により回収した.この時の Mo-Te 酸化物の収率は 0.3% (Mo 基準)であった.

2.2 Mo-Se 酸化物の合成

(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O (1.766g, Mo10mmol) を 水 20mL に溶解させ, SeO₂ (0.189g, 1.7mmol) を加えた. 溶液の pH を H₂SO₄ (1M) を用いて 2.8 に調節し, 溶液 を室温で 10 分間撹拌した (黄色固体が生成). 続いて, N₂ で 10min バブリングした後, 混合溶液を 50mL のテ フロンライナーに移し, ステンレス製オートクレーブに て 448K にて 24h 水熱合成を行った.オートクレーブを 室温に冷却した後, 得られた固体を濾過により溶液から 回収した.得られた固体を水 10mL で 3 回洗浄し, 一晩, 353K で乾燥し, Mo-Se 酸化物 0.17g を (9.6% の収率) を得た.元素分析結果:計算値 N₂Mo₆Se₁O₂₃H₁₂; N, 2.64; Mo, 54.17; Se, 7.43; H, 1.13, 実測値: N, 2.72; Mo, 54.19; Se, 7.58; H, 1.25.

2.3 プロトンとのイオン交換処理

Mo-Te 酸化物又は Mo-Se 酸化物(0.9g)を水24mL 中 に分散させ,塩酸(36%,2mL)を溶液に添加し,15h 攪拌した.得られた固体を濾過により回収し,室温で 乾燥させた.元素分析結果,計算値 N_{1.1}Mo₆Te₁O₂₆H_{15.3} (H-Mo-Te 酸化物); N, 1.34; Mo, 50.06; Te, 11.10; H, 1.33, 実験値: N, 1.44; Mo, 50.34; Te, 11.18; H, 1.51.元素分 析結 N_{1.1}Mo₆Se₁O₂₇H_{17.3}; (H-Mo-Se 酸化物); N, 1.38; Mo, 51.43; Se, 7.05; H, 1.55, 実験値: N, 1.52; Mo, 51.68; Se, 7.05; H, 1.58.

2.4 分子ワイヤの分離

H-Mo-Te 酸化物または H-Mo-Se 酸化物(5mg)をエタ ノール 5mL に分散させ 1h 超音波処理(200W, 37 キロ ヘルツ)した.その後,溶液を3500rpm(2h)にて遠心 分離した.コロイドの上部 50%をキャラクタリゼーショ ンに利用した.溶液中の残りの固体重量を測定すること により,コロイド溶液には約 2wt%の H-Mo-Te 酸化物の ナノ粒子が含まれることを確認した.

2.5 触媒活性の評価

触媒(0.1g)をエタノール 5mL に分散させた. 酢酸 (0.1mL)およびデカン(0.1mL)をエタノール溶液に加え, 365K にて反応を行った. 生成物は水素炎イオン化検出器 (GC-FID)を用いて分析し,転化率は酢酸基準で計算した. 全ての実験において,カーボンバランスは95%以上,酢 酸エチル選択率は99%以上であった.

2.6 サンプルの熱処理

Mo-Te 酸化物 (0.1g) を設定温度にて 1h, N₂ 流通下 (180mL min⁻¹) にて熱処理した.

2.7 キャラクタリゼーション

微細構造の測定は、文部科学省ナノテクノロジープ ラットフォーム事業・微細構造解析プラットフォーム(北 海道大学)の装置を利用して行った.走査型電子顕微鏡 (SEM)による形状測定は、超薄膜評価装置(HD-2000, 日立)を用いて行った.透過型電子顕微鏡による高分 解能の結晶構造像測定は、JEM-2010F(200-kV TEM, JEOL)にて行った.その他のキャラクタリゼーションは、 既報の文献に従って行った.[18]



3.1 酸化物の合成とキャラクタリゼーション

水熱条件下において Mo 前駆体の (NH₄)₆Mo₇O₂₄•4H₂O と, Se^{IV} または Te^{IV} イオンとを反応させ, Mo-Se 酸化物 または Mo-Te 酸化物を合成した.前駆体の Se, Te イオ ンの酸化状態は IV 価であることが重要であり, Mo-Se 酸 化物は, (NH₄)₆Mo₇O₂₄•4H₂O と Se^{IV}O₂ 溶液の水熱合成に より容易に得ることができた. Mo-Te 酸化物を合成する 場合,水溶性の Te^{VI}(OH)₆ に還元剤 (VOSO₄•5H₂O) を加 え Te^{IV} イオンを生成することにより,目的の Mo-Te 酸化 物が得られた.

得られた酸化物の Mo, Te 及び Se の酸化数は, X 線光 電子分光法 (XPS) の結果, 各々 Mo^{VI}, Te^{IV}, Se^{IV} であった. Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物の紫外 - 可視 (UV-vis) の スペクトルにおいても, Mo^V に起因する 500 ~ 600nm の吸収は観測されず,酸化物中の Mo 種は Mo^{VI} として存 在することを確認した. 元素分析, XPS, およびエネル

ギー分散型 X 線分光法(EDX)により, Mo-Te 酸化物に は前駆体溶液に加えた V 種が存在しないことを確認した. 従って, V種は酸化物を形成せずに Te^{VI}(OH)₆を Te^{IV} イオ ンとする還元剤として作用したと考えられる. Mo-Te 酸 化物及び Mo-Se 酸化物の粉末 X 線回折(XRD)パターン を図1に示す. Mo-Te酸化物及び Mo-Se酸化物は三方晶 に指数付けされ,格子定数は a=12.48Å, c=3.94Å (Mo-Te 酸化物), a=12.51Å, c=3.93Å (Mo-Se 酸化物) であっ たため、2つの酸化物は類似の構造であると示唆された. Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物の赤外(FT-IR) スペク トルも類似しており、両者共に水和水のH₂O(1,620cm ⁻¹)および前駆体由来のNH₄⁺(1,400cm⁻¹)が存在 した. H₂O および NH₄⁺の存在は,昇温脱離質量分析法 (TPD-MS) および TG-DTA によって定性・定量をした. これら結果と元素分析結果を合わせると、Mo-Te 酸化物 及び Mo-Se 酸化物の元素比は Mo:Te:NH₄⁺:H₂O=6:1:2:3, Mo:Se:NH₄⁺:H₂O=6:1:2:2 であった.

合成した酸化物の走査型電子顕微鏡(SEM)を図2に 示す. Mo-Te酸化物および Mo-Se酸化物の形態は異なっ ており, Mo-Te酸化物が棒状粒子であったのに対し,



図1 水熱合成により得られた Mo-Te 酸化物 (a) および Mo-Se 酸化物 (b) の XRD パターン, およびリートベルト解析の結果 (a, R_{vo}=7.06%; b, R_{vo}=7.49%). 挿入図は高角度側の拡大図



3 µm

800 nm

5 µm

図 2 (a)水熱合成した Mo-Te 酸化物,(b)水熱合成した Mo-Se 酸化物,および(c)低温にて結晶化した Mo-Te 酸化物

Mo-Se 酸化物は板状粒子であった.水熱合成により得ら れた Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物は,単結晶構造解析 に用いるには小さかったため,低温にて結晶化する方法 を用いて,比較的大きな Mo-Te 酸化物の単結晶を得た. この低温で得られた Mo-Te 酸化物の XRD および FT-IR は, 水熱合成で得られた Mo-Te 酸化物と同様であり,基本構 造が同一であることを確認した.

低温で得られた Mo-Te 酸化物の元素分析および単結晶 X 線構造解析から得られた構造を図3に示した. *a-b* 面方 向から見ると 6 つの MoO₆ 八面体が Te イオンの周りに配 置し, $[Te^{IV}Mo^{VI}_6O_{21}]^2 - の分子ユニットを形成することが$ $分かった (図3a, b). この <math>[Te^{IV}Mo^{VI}_6O_{21}]^2 - ユニットは,$ 2 つの MoO₆ 八面体ユニットが稜共有で接合して 2 量体 を形成し, 2 量体が頂点共有した六角形構造であった. Te はユニットの中心に位置し, 3 つの酸素原子に配位し ていた. 六角形 $[\text{TeMo}_6O_{21}]^2$ -ユニットは, MoO₆ 八面体 ユニットが頂点共有で*c*軸方向に積層し分子ワイヤを形 成していた(図 3c). Te 間の距離は 3.94Å であるため, Te 間には相互作用はないと考えられる. 分子ワイヤは図 3d に示すように規則的に配列しており, 分子ワイヤ間に NH₄⁺と H₂O が配位していた. この, ナノワイヤの幅は約 1.2nm であった.

SEM 画像より Mo-Te 系酸化物結晶のサイズ分布の結果 を図4に示した.棒状粒子の幅は50~200nm(極大値 150nm)であり,長さは500~3,000nm(極大値1,500nm) であった.これは,3,800以上の六角形 [TeMo₆O₂₁]²⁻ユ ニットが*c*軸方向に沿って蓄積されたことを示す.

水熱合成で得られた Mo-Te 酸化物および Mo-Se 酸化物の構造を,低温にて得られた Mo-Te 酸化物の構造に基づき XRD パターンのリートベルト解析を用いて計算を行っ



図 3 得られた酸化物のモデル図. (a) [Te[™]Mo[™]₆O₂₁]^{2−}または [Se[™]Mo[™]₆O₂₁]^{2−}ユニットの多面体図 (b) [Te[™]Mo[™]₆O₂₁]^{2−}または [Se[™]Mo[™]₆O₂₁]^{2−}の Ball-and-Stick 表記, (c) Mo-Te 酸化物の分子ワイヤ. (六角形ユニットを結ぶ架橋酸素原子を黄色で示す.) (d) 結晶性 Mo-Te 酸化物(または Mo-Se 酸化物)(分子ワイヤが集積し規則的に配列する.) Mo:青色, Te(Se):茶色, O:赤.



図 4 SEM 像より得られた Mo-Te 酸化物結晶のサイズ分布, および TEM 像より得られた H-Mo-Te ナノワイヤのサイズ分布. (粒子カウント数:800 個)

た (図 1). リートベルト解析による酸化物のシミュレー トパターンは、実験データと一致し、Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物の R_{wp} 値は、各々7.06% および7.49% で あった. これら基本構造は低温にて得られた Mo-Te 酸化 物と同じであり、また、不純物ピークは観察されず単一 の結晶相であった. これらの結果より、Mo-Te 酸化物の 化学式は、 $(NH_4)_2[Te^{IV}Mo^{VI}_6O_{21}]\cdot 3H_2O$ と表記され、Mo-Se 酸化物の化学式は $(NH_4)_2[Se^{IV}Mo^{VI}_6O_{21}]\cdot 2H_2O$ と表記でき る.以上のように、Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物は、 $[X^{IV}Mo^{VI}_6O_{21}]^{2-}$ (X=Te, Se) モノマーが *c* 軸方向に積層 したナノワイヤが規則的に集積した、無機ポリマーでの 集合体であった.

3.2 結晶からの分子ワイヤの単離

結晶の配向が Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物結晶では 異なるため,高分解能透過型電子顕微鏡(HR-TEM)によ り,各酸化物の異なる格子面を観察することができた(図 5). Mo-Te 酸化物では,分子ワイヤが約 1.1nm の距離で c 軸方向に平行に規則的に配列しており, $[TeMo_6O_{21}]^2 - ユ$ ニット間の距離は約 0.4nm であった. Mo-Se 酸化物では,<math>a-b 面方向から分子ワイヤが観察でき,六角形の $[SeMo_6O_{21}]^2 - ユニットが規則的に配列しているのが分$ かった. これらの HR-TEM 画像は,構造解析の結果とよく一致した.

結晶中の分子ワイヤの単離を試みた.まず,H⁺により NH₄⁺のイオン交換処理を行い(H-Mo-Te 酸化物,H-Mo-Se 酸化物),XRD,FT-IR および元素分析を行った.その 結果,NH₄⁺の約半分がH⁺によって置換され,Mo-Te 酸 化物および Mo-Se 酸化物に特徴的な IR スペクトルは変化 せずに,分子ワイヤ間が拡大したことが分かった.これは, プロトン交換により,酸化物結晶から分子ワイヤがとれ たことを示す.次に,H-Mo-Te 酸化物をエタノール中に 分散させ超音波処理したところ,超音波処理後のサンプ ルの HR-TEM 観察により,1.5nm の幅を有する分子ワイ ヤが観察できた(図 6c).さらに,単離した H-Mo-Te 酸 化物のナノワイヤを原子間力顕微鏡(AFM)によって観察したところ(図 6d),ワイヤ状の粒子が確認され,その厚みが約 1.2nm(i)と約 4.8nm(ii)であり,構造解析や TEM 画像から得られたワイヤの幅(ワイヤ 1 層の厚み)と一致した.そのモデル図を図 6f に示した.ワイヤ粒子に比べ AFM カンチレバーが大きいため,AFM 像にてワイヤ粒子の幅の正確な値を見積もることは困難であった.

同様に処理した H-Mo-Se 酸化物コロイドの TEM (図 6i) 及び AFM (図 6j) の画像は, H-Mo-Te 酸化物とは異 なり, 六角形状のナノプレートであった. ナノプレート の厚さは約 1.6nm であり (図 6k), (NH₄)_{1.1}[H_{0.9}SeMo₆O₂₁] ユニットが *c* 軸方向へ 4 層分積層した厚さに相当した (図 6l).

以上のように,分子ワイヤが規則的に集積した Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物は,酸によるプロトン交換処理 と超音波処理をすることで,構造中の分子ワイヤを容易 に単離することができた.

3.3 H-Mo-Te 系酸化物ナノワイヤの酸触媒作用

ナノ材料は、大きな比表面積を有するため触媒反応への応用が期待できる。前述の通り、Mo-Te 酸化物中のNH₄⁺の約半分はH⁺に置換できたため、この酸化物は酸 性質を有すると考えられる。H-Mo-Te 酸化物を触媒として用い、酢酸とエタノールのエステル化反応を 365K で 行った結果を図7に示す。超音波処理を行っていない(分 子ワイヤが集積した)H-Mo-Te 酸化物を用いたところ、 反応時間 22h における酢酸の転化率は 17% であり、無 触媒での反応(11%)とあまり変化なく低活性であった。 超音波処理後のH-Mo-Te 酸化物ナノワイヤの触媒活性は、 転化率が 58% と大きく向上した。既存の均一系の酸触媒 である H₃PW₁₂O₄₀(30%)や H₃PMO₁₂O₄₀(38%)と比較 しても高い活性を有していた。H-Mo-Te 酸化物ナノワイ ヤはコロイド状であり、活性のわずかな減少があるもの の3回りサイクルが可能であった。



図5 Mo-Te 酸化物および Mo-Se 酸化物の HR-TEM 像,および多面体構造図.



図 6 Mo-Te 酸化物および Mo-Se 酸化物のプロトン処理および超音波処理による分子ワイヤの単離プロセス.
(a) Mo-Te 酸化物からの分子ワイヤの単離の模式図,(b) H-Mo-Te 酸化物の SEM 像,
(c) H-Mo-Te 酸化物コロイドの HR-TEM 像,(d) H-Mo-Te 酸化物コロイドの AFM 像,(e) AFM 像のラインプロファイル,
(f) AFM 像より得られた構造の模式図.(*a-b* 面の最上層の Mo を黄色で示した),(g) Mo-Se 酸化物からのナノプレートの単離の模式図,
(h) H-Mo-Se 酸化物の SEM 像,(i) H-Mo-Se 酸化物コロイドの HR-TEM 像,(j) H-Mo-Se 酸化物コロイドの AFM 像,
(k) AFM 像のラインプロファイル,(l) AFM 像より得られた構造の模式図.(*a-b* 面の最上層の Mo を黄色で示した))



図7 エタノールと酢酸のエステル化反応. (反応条件:触媒 0.1mg, エタノール 5mL, 酢酸 0.1mL, デカン(内部標準)0.1mL, 反応温度 365K(酢酸エチルへの選択率 >99%, カーボンバランス >95%))



図 8 (a) DR-UV-vis スペクトル (b) h_V vs. (αh_V)²のプロット (α:吸収係数). (挿入図:熱処理温度とバンドギャップの関係)

3.4 Mo-Te 系酸化物のバンドギャップの制御

ー次元ナノ構造材料は、機能性材料や導電性材料とし てナノエレクトロニクスの分野への応用も期待されてい る.また、ナノ構造を有するモリブデン酸化物は、電子 デバイスへの応用も報告されている。Mo-Te 酸化物は、 ナノワイヤの集積体であるため、このような電子デバイ スへの応用が期待できる。電子材料用途においては、電 気伝導が重要であるが、α-MoO₃のような6価のモリブ デン酸化物は、大きなバンドギャップ (>2.7eV)を有し ており、導電性が不十分なため半導体としては適さない。 この場合、還元反応によって Mo^{VI} を生成し、酸化物のバ ンドギャップを減少させる処理が必要である。

Mo-Te 酸化物は、単純な熱処理により還元剤を用いず に Mo の酸化状態をコントロールし、バンドギャップを連 続的に調節することができる。Mo-Te 酸化物を、N₂ 気流 下にて 473K ~ 573K で処理したところ、分子ワイヤ間に 存在する H_2O や NH_3 (NH_4 ⁺由来)の脱離によって、間隙 が縮小したものの基本的な構造に変化は生じなかった。

Mo-Te 酸化物は、熱処理温度の増加により徐々に Mo の還元種の生成に伴い青味を帯びた色に変化した.UV-vis スペクトルにおいてもこの変化の様子が確認できた(図 8a).UV-vis スペクトルからバンドギャップを算出した ところ、Mo種の還元に伴いバンドギャップが減少したこ とを示した(図8b).熱処理前の Mo-Te 酸化物のバンド ギャップは 2.93eV であり、熱処理後のバンドギャップは 2.28eV に低下した.



Se^{IV} または Te^{IV} と Mo-O 八面体による遷移金属酸化物 ベースの分子ワイヤ({(NH₄)₂[X^{IV}Mo^{VI}₆O₂₁]}_n)を合成する ことに成功した. Mo-Te 酸化物及び Mo-Se 酸化物の構造 は,単結晶 X 線分析および XPS, FT-IR と結合粉末 XRD リー トベルト解析,元素分析によって決定した.

金属酸化物の分子ワイヤは酸触媒活性を示し、分子ワ イヤを用いた不均一触媒の利用が期待できる.また、熱 処理によりバンドギャップを容易に変化できることも明 らかとなった.これら分子ワイヤベースの材料は、サー モクロミック材料、半導体、ならびに他の関連分野での 応用が期待できる.



本研究成果は、文部科学省ナノテクノロジープラット フォーム事業・微細構造解析プラットフォーム(北海道 大学)の支援を受けて実施されました.この場をお借り して厚く御礼申し上げます.



[1] B. H. Hong, S. C. Bae, C. W. Lee, S. Jeong, K. S. Kim,

Science 294, 348-351 (2001).

- [2] T. Ernst, *Science* **340**, 1414-1415 (2013).
- [3] K. Storm, et al., Nat. Nanotechnol. 7, 718-722 (2012).
- [4] J. V. Holm, et al., Nat. Commun. 4, 1498 (2013).
- [5] K. Tomioka, M. Yoshimura, T. A. Fukui, *Nature* 488, 189-192 (2012).
- [6] J. Wallentin, et al., Science 339, 1057-1060 (2013).
- [7] M. Heiss, et al., Nat. Mater. 12, 439-444 (2013).
- [8] L. Ouyang, K. N. Maher, C. L. Yu, J. Mccarty, H. Park, J. Am. Chem. Soc. 129, 133-138 (2007).
- [9] T. Schumacher, H. Giessen, M. Lippitz, *Nano Lett.* 13, 1706-1710 (2013).
- [10] R. Laocharoensuk, et al., Nat. Nanotechnol. 8, 660-666 (2013).
- [11]X. Liu, et al., Nat. Commun. 5, 4007 (2014).
- [12] J. Joo, B. Y. Chow, M. Prakash, E. S. Boyden, J. M. Jacobson, *Nat. Mater.* **10**, 596-601 (2011).
- [13] A. Koka, H. A. Sodano, Nat. Commun. 4, 2682 (2013).
- [14] C. M. Gothard, N. A. Rao, J. S. Nowick, *J. Am. Chem. Soc.* 129, 7272-7273 (2007).
- [15] H. Sakaguchi, H. Matsumura, H. Gong, *Nat. Mater.* 3, 551-557 (2004).
- [16] W. B. Davis, W. A. Svec, M. A. Ratner, M. R.

Wasielewski, Nature 396, 60-63 (1998).

- [17] R. N. Mahato, et al., Science 341, 257-260 (2013).
- [18] Z. Zhang, T. Murayama, M. Sadakane, H. Ariga, N. Yasuda, N. Sakaguchi, K. Asakura, W. Ueda, *Nature Commun*, 6, 7731 (2015).
- [19] M. Remskar, et al., Science 292, 479-481 (2001).
- [20] D. Mihailovic, Prog. Mater. Sci. 54, 309-350 (2009).
- [21] D.-L. Long, R. Tsunashima, L. Cronin, Angew. Chem. Int. Ed. 49, 1736-1758 (2010).
- [22] C. L. Hill; Ed.; Chem. Rev. 98, 1-390 (1998).
- [23] L. Cronin, A. Müller; Ed.; Chem. Soc. Rev. 41, 7325-7648 (2012).
- [24] R. Ma, T. Sasaki, Adv. Mater. 22, 5082-5104 (2010).
- [25] V. Nicolosi, M. Chhowalla, M. G. Kanatzidis, M. S. Strano, J. N. Coleman, *Science* **340**, 1226419 (2013).
- [26] J. R. Galán-Mascarós, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 34, 1460-1462 (1995).
- [27] L. Chen, et al., Cryst. Growth Des. 1913-1923 (2011).
- [28] Y. Wang, et al., Chem. Commun. 49, 306-308 (2013).
- [29] S. Balendhran, et al., Adv. Mater. 25, 109-114 (2013).

(首都大学東京 村山 徹)



微細構造解析プラットフォーム 北海道大学 む011-706-9340 E-mail nanoplat@cris.hokudai.ac.jp

ホームページ

【お問い合わせ】

http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat